

平成 29 年 8 月 24 日

学振第 175 委員会 委員各位

学振 175 委員会 次世代シリコン太陽電池分科会 幹事

次世代シリコン太陽電池分科会 第 7 回研究会開催のお知らせ

下記日程にて、次世代シリコン太陽電池分科会 第 7 回研究会を開催する運びとなりました。本研究会では、太陽電池の構造において太陽電池性能に大きな影響を及ぼす表面・界面に着目し、それらの関連技術や評価法などについて取り上げます。多くの皆様のご参加をお待ちしております。

記

日時：2017 年 10 月 19 日（木） 13 時 30 分～

場所：東京工業大学 大岡山キャンパス 東工大蔵前会館 3F 手島精一会議室  
(〒152-8550 東京都目黒区大岡山 2-12-1)

交通アクセス：<http://www.somuka.titech.ac.jp/ttf/access/>

プログラム

- |             |  |                   |
|-------------|--|-------------------|
| 13:30~13:35 | 「はじめに」   | 名古屋大学 宇佐美 徳隆      |
| 13:35~14:05 | 「Suppress surface recombination by introducing metal cations into AlO <sub>x</sub> 」 | 豊田工業大学 Hyunju Lee |
| 14:05~14:35 | 「LIA 支援反応性スパッタ装置によるアルミナ膜の太陽電池への応用」<br>SCREEN ファインテックソリューションズ 大澤 篤史                   |                   |
| 14:35~15:05 | 「ミスト CVD 法による酸化膜形成」  | 兵庫県立大学 新船 幸二      |
| 15:05~15:25 | — 休憩 —   |                   |
| 15:25~15:55 | 「シリコン太陽電池向け非質量分離型イオン注入技術」  | アルバック 山口 昇        |
| 15:55~16:25 | 「μ シェブロンレーザによる Si/Ge 薄膜単結晶帯形成と双晶欠陥分析」  | 島根大学 葉 文昌         |
| 16:25~16:55 | 「対向ターゲットスパッタによる a-Si:H<br>パッシベーション膜とその界面特性」  | 東京工業大学 宮島 晋介      |
| 16:55~17:00 | 「おわりに」   | 豊田工業大学 大下 祥雄      |
| 17:30~19:30 | 意見交換会  |                   |

## 参加申し込みの御案内

研究会参加費：無料

参加資格：学振 175 委員会委員および委員の所属する機関のどなたでも参加できます。同一機関から複数名の参加を認めます。学界委員には交通費を支給いたします（希望者のみ）

意見交換会費及び会場：おっってお知らせいたします

申し込み締め切り：2017年10月10日(火)

申し込み先：古川（175 委員会庶務担当幹事・東工大）  
furukawa.k.aa@m.titech.ac.jp まで下記事項を記入の上お申し込みください。

- ① 氏名
- ② 所属機関、部署
- ③ e-mail アドレス
- ④ 参加者の区分（学界委員（代理を含む）、産業界委員（代理を含む）、その他）
- ⑤ 意見交換会

申し込み以外の問い合わせは、宮島（東京工業大学、miyajima.s.aa@m.titech.ac.jp）までお願い致します。

以上